
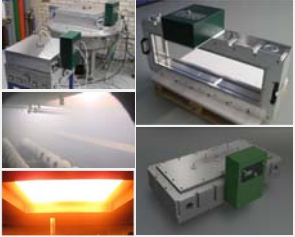


プロセス	モデル*	仕様	CCR Technology
PECVD	 <p>DN-シリーズ[®] -PECVD -クリーニング -表面活性化 -エッチング</p>	圧力範囲: 5E-4 から 1E-1 典型的な動作圧力: 1E-2 投入パワー: 0.6 から 5 kW 基板サイズ: 径3から 12インチ	
	 <p>LS-シリーズ[®] -PECVD -クリーニング -表面活性化</p>	圧力範囲: 5E-4 から 1E-1 典型的な動作圧力: 1E-2 投入パワー: 3 から 6 kW 基板サイズ: 280 から 1400 mm	
	 <p>RS-シリーズ[®] -PECVD -クリーニング -表面活性化 -エッチング</p>	圧力範囲: 5E-4 から 1E-1 典型的な動作圧力: 1E-2 投入パワー: 5 から 15 kW 基板サイズ: 900 から 1100 mm (註1) 400x400 から 700x700 (註2) (註1) 基板搬送型装置 (註2) 静止対向型装置	
PVD アシスト	 <p>DN-シリーズ[®] -スパッタアシスト -クリーニング -表面活性化</p>	圧力範囲: 1E-4 から 1E-2 典型的な動作圧力: 1E-3 投入パワー: 0.6 から 5 kW 基板サイズ: 径3から 12インチ	
	 <p>LS-シリーズ[®] -スパッタアシスト -クリーニング -表面活性化</p>	圧力範囲: 1E-4 から 1E-2 典型的な動作圧力: 1E-3 投入パワー: 3 から 6 kW 基板サイズ: 280 から 1500 mm	
	 <p>IS-シリーズ[®] -蒸着アシスト -エッチング -クリーニング -表面活性化 *アプリケーションは実績に基づいた典型例です。</p>	圧力範囲: 1E-4 から 1E-2 典型的な動作圧力: 1E-4 投入パワー: 1.2 から 5 kW キャロット/ドームサイズ: 550 から 2000 mm	